

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成22年12月2日(2010.12.2)

【公開番号】特開2009-98653(P2009-98653A)

【公開日】平成21年5月7日(2009.5.7)

【年通号数】公開・登録公報2009-018

【出願番号】特願2008-236593(P2008-236593)

【国際特許分類】

G 02 B 5/30 (2006.01)

G 02 F 1/1335 (2006.01)

【F I】

G 02 B 5/30

G 02 F 1/1335 5 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月19日(2010.10.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材層と親水性高分子層が積層されている積層体が延伸処理されている延伸積層体であり、かつ親水性高分子層には少なくとも二色性物質が吸着されている延伸積層体を含有する偏光板であって、

前記延伸積層体における親水性高分子層は、厚みが2～10μmであり、

前記延伸積層体における基材層は、厚みが5～100μmであり、かつ透湿度が120g/m²/24h以下の範囲であり、

前記延伸積層体における親水性高分子層が偏光子として機能し、前記延伸積層体における基材層が偏光子の透明保護フィルムとして用いられることを特徴とする偏光板。

【請求項2】

基材層と親水性高分子層が積層されている積層体は、基材層に、親水性高分子を含有する水溶液を塗工した後に、乾燥することにより得られたものであることを特徴とする請求項1記載の偏光板。

【請求項3】

基材層と親水性高分子層が積層されている積層体は、基材層の形成材と、親水性高分子層の形成材の共押出により形成したものであることを特徴とする請求項1記載の偏光板。

【請求項4】

基材層と親水性高分子層が積層されている積層体は、基材層と親水性高分子層が直接積層されていることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の偏光板。

【請求項5】

親水性高分子層を形成する親水性高分子が、ポリビニルアルコール系樹脂であることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の偏光板。

【請求項6】

親水性高分子層が、架橋処理されていることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の偏光板。

【請求項7】

請求項1～6のいずれかに記載の偏光板が、少なくとも1枚積層されていることを特徴

とする光学フィルム。

【請求項 8】

請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の偏光板または請求項 9 記載の光学フィルムが用いられていることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 9】

基材層上に親水性高分子を含有する溶液を塗工した後、前記親水性高分子を含有する溶液を乾燥することにより、前記基材層上に親水性高分子層を形成して、基材層と親水性高分子層が積層されている積層体にする工程、

前記積層体に、延伸処理を施して延伸積層体にする延伸工程、および

前記積層体または前記延伸積層体の親水性高分子層に、二色性物質を吸着させる染色工程、を含む偏光板の製造方法であって、

前記延伸工程で施される延伸処理は、

前記延伸積層体における親水性高分子層の厚みが 2 ~ 10 μm であり、

前記延伸積層体における基材層の厚みが 5 ~ 100 μm であり、かつ該基材層の透湿度が 120 g / m² / 24 h 以下の範囲となるようにすることを特徴とする偏光板の製造方法。

【請求項 10】

基材層の形成材と、親水性高分子層の形成材の共押出により、基材層と親水性高分子層が積層されている積層体にする工程、

前記積層体に、延伸処理を施して延伸積層体にする延伸工程、および

前記積層体または前記延伸積層体の親水性高分子層に、二色性物質を吸着させる染色工程、を含む偏光板の製造方法であって、

前記延伸工程で施される延伸処理は、

前記延伸積層体における親水性高分子層の厚みが 2 ~ 10 μm であり、

前記延伸積層体における基材層の厚みが 5 ~ 100 μm であり、かつ該基材層の透湿度が 120 g / m² / 24 h 以下の範囲となるようにすることを特徴とする偏光板の製造方法。

【請求項 11】

親水性高分子層を形成する親水性高分子が、ポリビニルアルコール系樹脂であることを特徴とする請求項 9 または 10 記載の偏光板の製造方法。

【請求項 12】

さらに、前記積層体の親水性高分子層に、架橋処理を施す工程を有することを特徴とする請求項 9 ~ 11 のいずれかに記載の偏光板の製造方法。